(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 6. Oktober 2005 (06.10.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/092933 A1

- C08F 2/44, (51) Internationale Patentklassifikation⁷: C03C 17/30, C08K 9/06, C09C 3/12, 1/28
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002542
- (22) Internationales Anmeldedatum:

10. März 2005 (10.03.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

25. März 2004 (25.03.2004) 10 2004 014 684.5 DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMIS-CHE INDUSTRIE GMBH [DE/DE]; Zielstattstr. 20, 81379 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRIEHN, Christoph [DE/DE]; Plinganserstr. 132, 81369 München (DE). STANJEK, Volker [DE/DE]; Hofbrunnstr. 21, 81479 München (DE). JUNG-ROSSETTI, Silvia [DE/DE]; Jutastr. 18, 80636 München (DE). KNEZEVIC, Christine [DE/DE]; Ebermayerstr. 20, 81369 München (DE).

- (74) Anwälte: FRITZ, Helmut usw.; c/o Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: CURABLE COMPOSITION CONTAINING SURFACE-MODIFIED PARTICLES
- (54) Bezeichnung: OBERFLÄCHENMODIFIZIERTE PARTIKEL ENTHALTENDE HÄRTBARE ZUSAMMENSETZUNG

$$-SiR^{2}_{2}-(CR^{3}_{2})_{n}-A-D-C$$
 (I)

(57) Abstract: The invention relates to curable compositions Z, which contain a binding agent BM that carries at least one ethylenically unsaturated group, in addition to particles P that have at least one ethylenically unsaturated group on their

surface and comprise groups of general formula (I), $-SiR^2_2$ -(CR^3_2)_n-A-D-C. In said formula, R^2 represents $-(CR^3_2)_n$ -A-D-C or a hydrocarbon group comprising between 1 and 12 carbon atoms, the carbon chain of said hydrocarbon group being interrupted by non-adjacent oxygen, sulphur or NR⁴ groups, R³ represents hydrogen or a hydrocarbon group comprising between 1 and 12 carbon atoms, the carbon chain of said hydrocarbon group being interrupted by non-adjacent oxygen, sulphur or NR4 groups, R4 represents hydrogen or a hydrocarbon group comprising between 1 and 12 carbon atoms, A represents oxygen, sulphur, =NR⁴ or =N-(D?C), D represents a carbonyl group, or an alkene, cycloalkene or arylene group comprising between 1 and 12 carbon atoms, the carbon chain being interrupted by non-adjacent oxygen, sulphur, or NR⁴ groups, C represents a terminal unsaturated group and n represents values that are greater than or equal to 1.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung sind härtbare Zusammensetzungen Z, die ein Bindemittel BM, das mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe trägt, sowie Partikel P enthalten, die über mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe an ihrer Oberfläche verfügen und Reste der allgemeinen Formel (I), -SiR²₂-(CR³₂)n-A-D-C aufweisen, wobei R² - (CR³₂)_n-A-D-C oder ein Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR⁴-Gruppen unterbrochen sein kann, R³ Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR⁴-Gruppen unterbrochen sein kann, R⁴ Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, A Sauerstoff, Schwefel, =NR⁴ oder =N-(D--C), D Carbonylgruppe, Alkylen-, Cycloalkylen- oder Arylenrest mit jeweils 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, wobei die Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR4-Gruppen unterbrochen sein kann, C eine endständige ungesättigte Gruppe und n Werte größer oder gleich 1 bedeuten.



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen. WO 2005/092933 PCT/EP2005/002542

Oberflächenmodifizierte Partikel enthaltende härtbare Zusammensetzung

Die Erfindung betrifft härtbare Zusammensetzungen, die ein Bindemittel, das mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe trägt, sowie Partikel enthalten, die über mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe an ihrer Oberfläche verfügen, sowie die Verwendung dieser Zusammensetzungen zur Beschichtung.

10

15

20

Radikalisch härtbare Beschichtungszusammensetzungen, die nanoskalige, mit organischen Resten oberflächenmodifizierte Füllstoffe enthalten und nach Härtung Beschichtungen mit hoher mechanischer Härte und Chemikalienbeständigkeit liefern, sind bekannt. Bei derartigen Beschichtungszusammensetzungen gewährleistet eine geeignete Modifikation der Partikel-oberfläche die Kompatibilität des Partikels mit der umgebenden Polymermatrix. Besitzt die Partikeloberfläche zudem eine geeignete Reaktivität gegenüber der Matrix, so dass sie unter den jeweiligen Härtungsbedingungen des Beschichtungssystems mit dem Bindemittelsystem reagieren kann, gelingt es, die Partikel während der Härtung chemisch in die Matrix einzubauen, was sich häufig positiv auf das Eigenschaftsprofil des Kompositsystems auswirkt.

25

30

Radikalisch härtbare partikelverstärkte Beschichtungszusammensetzungen sind u.a. in US 4455205 A und US 4491508 A
beschrieben und werden beispielsweise durch Umsetzung von
kolloidalem Siliciumdioxid mit 3-Methacryloxypropyltrimethoxsilan und dem anschließenden Austausch des wässrigen
und/oder alkoholischen Lösungsmittel gegen ein radikalisch
vernetzbares organisches Bindemittel erhalten. Derartige
Beschichtungszusammensetzungen können zur Beschichtung von
thermoplastischen Substraten eingesetzt werden.

35

Aus US 6306502 B sind Beschichtungszusammensetzungen für Kratzfestbeschichtungen bekannt, die aus kolloidalem

Siliciumdioxid und einem radikalisch polymerisierbaren Silan hergestellt werden können. Als Bindemittel wird hierbei ein (meth)acryloxyalkyl-funktionelles Isocyanurat eingesetzt. In DE 102 00 928 Al sind härtbare organische Dispersionen enthaltend oberflächenmodifizierte Nanopartikel beschrieben, die beispielsweise hergestellt werden, indem hydrophiles pyrogenes Siliciumdioxid nach einem Dispergierschritt in Dipentaerythritpentaacrylat mit 3-

Methacryloxypropyltrimethoxysilan, Aluminiumbutylat und Wasser vermischt wird. Derartige Dispersionen lassen sich insbesondere als Beschichtungsstoffe aber auch als Klebstoffe und Dichtungsmassen einsetzen.

Nach dem Stand der Technik werden die in den Beschichtungssystemen enthaltenen Partikel hergestellt, indem man Partikel, die über freie Siliciumhydroxid- (SiOH) oder Metallhydroxidfunktionen (MeOH) verfügen, mit Alkoxysilanen umsetzt, die als reaktive organische Funktion eine ethylenisch ungesättigte Gruppe, wie z.B. Vinyl, (Meth)acryl etc., enthalten. Sämtlichen im Stand der Technik zur Partikelfunktionalisierung eingesetzten Silanen ist dabei gemeinsam, dass sie über eine Di- oder Trialkoxysilylgruppe verfügen, wie dies z.B. beim Methacrylatopropyl-trimethoxysilan der Fall ist.

25

30

35

5

10

15

20

Werden zur Oberflächenfunktionalisierung Di- oder Trialkoxysilane eingesetzt, wird in Gegenwart von Wasser nach Hydrolyse und Kondensation der erhaltenen Silanole eine Siloxan-Hülle um den Partikel gebildet. In Macromol. Chem. Phys. 2003, 204, 375-383 wird die Ausbildung einer solchen Siloxan-Hülle um einen SiO2-Partikel beschrieben. Problematisch kann hierbei sein, dass die gebildete Siloxan-Hülle noch über eine große Anzahl von SiOH-Funktionen auf der Oberfläche verfügt. Die Stabilität derartiger SiOH-funktioneller Partikel ist unter den Bedingungen der Herstellung und Lagerung, auch in Gegenwart des Bindemittels, gegebenenfalls eingeschränkt. Es kann zur Aggregation bzw. Agglomeration der Partikel kommen. Die damit verbundene eingeschränkte Stabilität der Dispersionen erschwert

die Herstellung von Materialien mit reproduzierbaren Eigenschaften. Zudem ist ein großer Anteil der reaktiven organischen Funktionen in der Siloxan-Hülle sterisch so abgeschirmt, dass über diese Funktionen keine Anknüpfung der Partikel an das reaktive Bindemittel möglich ist. Idealerweise sollten aber sämtliche an der Partikeloberfläche angebundenen reaktiven organischen Funktionen für einen kovalenten Einbau an die Matrix zur Verfügung stehen.

10 Somit besitzen sämtliche bekannten partikelhaltigen
Bindemittelsysteme den Nachteil, sowohl in gehärteter und
ungehärteter Form oftmals nur schwer reproduzierbare
Eigenschaften aufzuweisen. Vor allem aber sind die mechanische
Härten - und insbesondere die Kratzfestigkeit - der
15 ausgehärteten Beschichtungen für viele Anwendungen noch nicht
ausreichend.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zu Grunde, ein mit aktinischer Strahlung oder thermisch härtbares Beschichtungssystem zur Verfügung zu stellen, das diese Nachteile der bekannten Systeme nicht mehr aufweist.

Gegenstand der Erfindung sind härtbare Zusammensetzungen Z, die ein Bindemittel BM, das mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe trägt, sowie Partikel P enthalten, die über mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe an ihrer Oberfläche verfügen und Reste der allgemeinen Formel I,

$$-SiR^{2}_{2}-(CR^{3}_{2})_{n}-A-D-C \qquad (I),$$

aufweisen, wobei

5

20

25

35

R² -(CR³₂)_n-A-D-C oder ein Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12
Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht
benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR⁴-Gruppen
unterbrochen sein kann,

R³ Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12

Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR⁴-Gruppen unterbrochen sein kann,

- R⁴ Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen,
- A Sauerstoff, Schwefel, =NR4 oder =N-(D--C),

5

10

20

30

35

- D Carbonylgruppe, Alkylen-, Cycloalkylen- oder Arylenrest mit jeweils 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, wobei die Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR4-Gruppen unterbrochen sein kann,
- C eine ethylenisch ungesättigte Gruppe und
- n Werte größer oder gleich 1 bedeuten.

Die härtbaren Zusammensetzungen Z enthalten Partikel P, die mittels der reaktiven ethylenisch ungesättigte Gruppe enthaltenden Reste der allgemeinen Formel I oberflächenmodifiziert sind, wobei sich die reaktiven Reste dadurch auszeichnen, dass die Silylgruppe drei über eine C-C-Bindung gebundene organische Reste trägt und über eine weitere Bindung an die Partikeloberfläche geknüpft ist. Die Kratzfestigkeit der härtbaren Zusammensetzungen Z ist dadurch gegenüber den bekannten Partikel enthaltenden Zusammensetzungen deutlich gesteigert.

- 25 Die Partikel P sind vorzugsweise herstellbar durch Umsetzung von
 - (a) Partikeln P1 aus einem Material, das ausgewählt wird aus Metalloxiden, Metall-Silicium-Mischoxiden, Siliciumdioxid, kolloidalem Siliciumdioxid und Organopolysiloxanharzen und deren Kombinationen, das über Funktionen verfügt, die ausgewählt werden aus Me-OH, Si-OH, Me-O-Me, Me-O-Si, Si-O-Si, Me-OR¹ und Si-OR¹,
 - (b) mit Organosilanen B der allgemeinen Formel II,

$$(R^{1}O) R^{2}, Si - (CR^{3}_{2})_{n} - A - D - C$$
 (II),

bzw. deren Hydrolyse und/oder Kondensationsprodukten,(c) und gegebenenfalls mit Wasser,

wobei

15

20

25

Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 6
Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR4-Gruppen unterbrochen sein kann,

Me ein Metallatom bedeuten und

10 R^2 , R^3 , A, D, C und n die vorstehenden Bedeutungen aufweisen.

Der Einsatz von monofunktionellen Organosilanen B der allgemeinen Formel II gestattet die Partikelfunktionalisierung auch in Abwesenheit von Wasser. Dabei lassen sich in einer stöchiometrischen Reaktion nahezu sämtliche MeOH- und/oder SiOH-Gruppen auf der Oberfläche des Partikels mit Organosilanen B absättigen. Verbleibende MeOH- und/oder SiOH-Gruppen, die die Stabilität der Partikel einschränken können, sind somit weitgehend vermeidbar. Auch frei zugängliche Me-O-Me, Me-O-Si oder Si-O-Si-Gruppen lassen sich in einer stöchiometrischen Reaktion durch Umsetzung mit Organosilanen B funktionalisieren.

Die Partikel P sind ebenfalls bevorzugt herstellbar durch Cohydrolyse von Organosilanen B der allgemeinen Formel II mit Alkoxysilanen B* der allgemeinen Formel III,

$$(R^5O)_{A=m}(R^6)_{m}Si$$
 (III),

wobei

30 R⁵ die Bedeutungen von R¹ aufweisen,

R⁶ Kohlenwasserstoffrest, der substituiert sein kann und m die Werte 0, 1, 2 oder 3 bedeuten.

Der Kohlenwasserstoffrest R¹ ist vorzugsweise ein Alkyl-,

Cycloalkyl- oder Arylrest, insbesondere Methyl-, Ethyl- oder

Phenylrest, besonders bevorzugt ein Methyl- oder Ethylrest. R² ist bevorzugt ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl- oder Arylalkylrest, insbesondere Methyl-, Ethyl- oder Phenylrest, besonders bevorzugt ein Methylrest. R^3 ist bevorzugt Wasserstoff oder Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl- oder Arylalkylrest. insbesondere Methyl-Rest, besonders bevorzugt handelt es sich bei bei den Resten R³ um Wasserstoff. n nimmt bevorzugt die Werte 1, 2 oder 3 an. Besonders bevorzugt ist $\mathbf{n} = 1$. Die Gruppe C ist vorzugsweise ein ungesättigter Alkylrest mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt mit 2 bis 6 10 Kohlenstoffatomen, insbesondere Vinyl, Acryl, Methacryl. Die Gruppen (-A-D-C) stehen bevorzugt für folgende Reste: $OC(O)C(CH_3) = CR^3$, $OC(O)CH = CR^3$, $NHC(O)C(CH_3) = CR^3$, oder NHC(O)CH=CR32. Besonders bevorzugt stehen sie für die Reste OC(O)C(CH₃)=CR³, oder OC(O)CH=CR³, Bevorzugte Reste für R⁵ sind 15

- bei den bevorzugten Resten R¹ aufgeführt. R⁶ ist bevorzugt ein funktionalisierter oder unfunktionalisierter z.B. aromatischer oder aliphatischer gesättigter oder ungesättigter Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen.

 20 Bevorzugte Reste für R⁶ sind bei den bevorzugten Resten R² und
- aufgeführt. R⁶ kann auch die Bedeutung CR³₂-A-D-C annehmen, d.h., in diesem Fall sind Organosilane B der allgemeinen Formel II mit Alkoxysilanen B* identisch.
- Bevorzugte Beispiele für Alkoxysilane B* sind Tetraethoxysilan, Tetramethoxysilan, Methyltrimethoxysilan, Dimethylmethoxysilan, Phenylmethyldimethoxysilan, Phenyltrimethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan.
- Die Zusammensetzungen Z werden bevorzugt als Beschichtungen eingesetzt. Besonders bevorzugt dienen sie dabei der Verbesserung der Kratzfestigkeit der beschichteten Oberfläche. Die aus Zusammensetzungen Z durch Härtung erhältlichen Beschichtungen weisen eine höhere mechanische Härte und verbesserte Kratzfestigkeit auf als vergleichbare

Beschichtungen, welche Partikel enthalten, die mit herkömmlichen trifunktionellen Alkoxysilanen, wie z.B. Methacrylatopropyltrimethoxysilan, bzw. deren Hydrolyse-und/oder Kondensationsprodukten oberflächenmodifiziert sind.

5

Aufgrund der hohen Reaktivität der Alkoxysilane B mit
Methylenspacer zwischen Alkoxysilylgruppe und einem Heteroatom
(n = 1) eignen sich diese Verbindungen besonders zur
Funktionalisierung von SiOH- bzw. MeOH-tragenden Partikeln P1.
Auch die Equilibrierung der Me-O-Me-, Me-O-Si-, Si-O-Sifunktionellen Partikel mit den Alkoxysilanen B kann zur
Herstellung der Partikel P durchgeführt werden. Die Umsetzungen
der Partikel P1 mit den Alkoxysilanen B verlaufen schnell und
vollständig.

Das in den Zusammensetzungen Z enthaltene Bindemittel BM muß

15

20

25

30

35

10

eine oder mehrere reaktionsfähige Gruppen tragen, die bevorzugt initiiert durch aktinische Strahlung oder thermische Behandlung unter Aufbau eines Polymers mit sich und den reaktionsfähigen Partikeln zu einer radikalischen, kationischen oder anionischen Polymerisation befähigt sind. Reaktionsfähige Gruppen sind Gruppen mit ethylenisch ungesättigten Funktionen, insbesondere Vinylgruppen, Methacrylatgruppen, Acrylatgruppen, Acrylamidgruppen. Das Bindemittel BM kann dabei sowohl monomere, oligomere oder auch polymere Verbindungen enthalten. Beispiele geeigneter monomerer und oligomerer Verbindungen sind Hexandioldiacrylat, Pentaerythrittriacrylat, Dipentaerythritpentaacrylat, Triethylenglycoldiacrylat etc. Beispiele geeigneter polymerer Bindemittel BM sind ethylenisch ungesättigte Gruppen tragende (Meth)acrylcopolymere, Polyester-(meth-)acrylate, unqesättigte Polyester, Urethan-(meth-)acrylate, Silicon-(meth-)acrylate.

Unter aktinischer Strahlung wird elektromagnetische Strahlung im Infrarot (NIR), im Sichtbaren, im Ultraviolett (UV) sowie im Bereich der Röntgenstrahlung verstanden.

Die Zusammensetzungen Z zeichnen sich dadurch aus, daß als Partikel P1 sämtliche Metalloxid- und Metallmischoxid-Partikel (z.B. Aluminiumoxide wie Korund, Aluminiummischoxide mit anderen Metallen und/oder Silicium, Titanoxide, Zirkonoxide, 5 Eisenoxide etc.), Siliciumoxid-Partikel (z.B. kolloidale Kieselsäure, pyrogene Kieselsäure, gefällte Kieselsäure, Kieselsole) oder Siliciumoxid-Verbindungen, bei denen einige Valenzen des Siliciums mit organischen Resten versehen sind (z.B. Siliconharze), eingesetzt werden. Die Partikel P1 10 zeichnen sich weiter dadurch aus, daß sie auf ihrer Oberfläche über Metall- (MeOH), Siliciumhydroxid- (SiOH), Me-O-Me-, Me-O-Si- und/oder Si-O-Si-Funktionen verfügen, über die eine Reaktion mit den Organosilanen B erfolgen kann. Die Partikel P1 besitzen bevorzugt einen mittleren Durchmesser von kleiner 1000 15 nm, besonders bevorzugt kleiner 100 nm, wobei die Teilchengröße durch Transmissionselektronenmikroskopie bestimmt wird.

In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung bestehen die Partikel P1 aus pyrogener Kieselsäure. In einer weiteren bevorzugten Ausführung der Erfindung werden als Partikel P1 kolloidale Silicium- oder Metalloxide eingesetzt, die bevorzugt als Dispersion der entsprechenden Oxidteilchen von Submikrongröße in einem wäßrigen oder organischen Lösungsmittel vorliegen. Dabei können bevorzugt die Oxide der Metalle Aluminium, Titan, Zirkonium, Tantal, Wolfram, Hafnium, Zinn verwendet werden. Bevorzugt werden wässrige SiO₂-Sole eingesetzt, die bevorzugt mit Organosilanen B der allgemeinen Formel II umgesetzt werden.

30

25

20

Ebenfalls bevorzugt eingesetzt werden zudem Partikel P1, die aus Siliconharzen der allgemeinen Formel IV

$$(R^{7}_{3}SiO_{1/2})_{e}(R^{7}_{2}SiO_{2/2})_{f}(R^{7}SiO_{3/2})_{g}(SiO_{4/2})_{h}$$
 (IV)

35

bestehen, wobei

- R⁷ eine OR⁸-Funktion, eine OH-Funktion, einen gegebenenfalls halogen-, hydroxyl-, amino-, epoxy-, thiol-, (meth)acryl-, oder NCO-substituierten Kohlenwasserstoffrest mit 1-18 Kohlenstoffatomen, wobei die Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR⁴-Gruppen unterbrochen sein kann,
- R⁸ einen gegebenenfalls substituierten einwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1-18 Kohlenstoffatomen,
- e einen Wert von größer oder gleich 0,
- 10 f einen Wert von größer oder gleich 0,

5

15

20

25

30

- g einen Wert von größer oder gleich 0 und
- h einen Wert von größer oder gleich 0 bedeuten, mit der
 Massgabe, dass die Summe aus $\mathbf{e} + \mathbf{f} + \mathbf{g} + \mathbf{h}$ mindestens 1,
 vorzugsweise mindestens 5 ist.

Für die Zusammensetzungen Z können ein oder mehrere verschiedene Partikeltypen P eingesetzt werden. So lassen sich beispielsweise Beschichtungssysteme herstellen, die neben nanoskaligem SiO_2 auch nanoskaligen Korund enthalten.

Die Menge der im Beschichtungssystem Z enthaltenen Partikel P beträgt, bezogen auf das Gesamtgewicht, vorzugsweise mindestens 5 Gew.-%, bevorzugt mindestens 10 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 15 Gew.-% und vorzugsweise höchstens 90 Gew.-%.

Die Herstellung der Zusammensetzungen Z erfolgt vorzugsweise in einem zweistufigen Verfahren. In der ersten Stufe werden die Partikel P hergestellt. Im zweiten Schritt werden die funktionalisierten Partikel P in das Bindemittel BM eingebracht.

In einem bevorzugten Verfahren wird der durch Umsetzung des Partikels P1 mit dem Organosilan B erhaltene Partikel P gereinigt, bevor er in das Bindemittel BM eingebracht wird. WO 2005/092933 PCT/EP2005/002542 10__

Dieses Vorgehen empfiehlt sich insbesondere dann, wenn sich die im Herstellungsprozess anfallenden Verunreinigungen negativ auf das Eigenschaftsprofil der (ausgehärteten) Beschichtung auswirken. Die Reinigung der Partikel P kann beispielsweise erfolgen, indem der Partikel ausgefällt und anschließend mit einem geeigneten Lösungsmittel gewaschen wird.

In einem alternativen Verfahren wird die Zusammensetzung Z hergestellt, indem die Partikel P1 in Gegenwart des Bindemittels BM mit den Silanen B funktionalisert werden. In beiden Herstellungsverfahren können die Partikel P1 sowohl als Dispersion in einem wässrigen oder auch wasserfreien Lösungsmittel als auch im festen Zustand vorliegen.

10

25

Werden dabei wässrige oder nichtwässrige Dispersionen der Partikel P1 verwendet, so wird das entsprechende Lösungsmittel nach dem Einbringen der Partikel P oder P1 in das Bindemittel BM in der Regel entfernt. Die Entfernung des Lösungsmittels erfolgt dabei bevorzugt destillativ, sie kann vor oder nach dem Umsatz der Partikel P1 mit den Silanen B erfolgen.

Beispiele für bevorzugt eingesetzte Silane B sind

Methacrylatomethyl-dimethylmethoxysilan, Methacrylatomethyldimethylethoxysilan, Methacrylatopropyl-dimethylmethoxysilan,

Methacrylatopropyl-dimethylethoxysilan, Acrylatomethyldimethylmethoxysilan, Acrylatomethyl-dimethylethoxysilan,

Acrylatopropyl-dimethylmethoxysilan und Acrylatopropyldimethylethoxysilan.

Zur Funktionalisierung der Partikel kann ein Silan B einzeln oder ein Gemisch verschiedener Silane B oder auch ein Gemisch aus Silanen B mit anderen Alkoxysilanen eingesetzt werden.

Die Zusammensetzungen Z können zudem gängige Lösungsmittel 35 sowie die in Formulierungen üblichen Additive und Zusätze enthalten. Zu nennen wären hier u.a. Verlaufshilfsmittel, oberflächenaktive Substanzen, Haftvermittler, Lichtschutzmittel wie UV-Absorber und/oder Radikalfänger, Thixotropiermittel sowie weitere Fest- und Füllstoffe. Zur Erzeugung der jeweils gewünschten Eigenschaftsprofile sowohl der Zusammensetzungen als auch der ausgehärteten Massen sind derartige Zusätze bevorzugt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zusammensetzungen Z als Beschichtungen eingesetzt werden sollen. Ebenso können diese Beschichtungsformulierungen auch Farbstoffe und/oder Pigmente enthalten.

Die Aushärtung der Zusammensetzung Z erfolgt bevorzugt durch aktinische Strahlung oder thermisch initiierte radikalische Polymerisation unter den für ethylenisch ungesättigte Gruppen erforderlichen Bedingungen in üblicher, dem Fachmann bekannter Weise.

Die Polymerisation erfolgt beispielsweise durch UV-Bestrahlung nach Zusatz geeigneter Photoinitiatoren wie z.B. Darocur® 1178, Darocur® 1174, Irgacure® 184, Irgacure® 500. Diese

Photoinitiatoren werden üblicherweise in Mengen von 0,1-5 Gew.- % eingesetzt. Thermisch lässt sich die Polymerisation nach Zugabe von organischen Peroxiden, wie z.B.

Peroxydicarbonsäuren, oder Azoverbindungen, wie z.B.

Azobisisobutyronitril, durchführen.

25

30

35

5

10

15

In einer besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung enthalten die Zusammensetzungen Z mindestens einen Photoinitiator und die Härtung der Beschichtung erfolgt durch UV-Strahlung. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung erfolgt die Aushärtung der Zusammensetzungen Z durch Elektronenstrahlen.

Die nach Aushärtung der Zusammensetzungen Z erhaltenen Beschichtungen besitzen hervorragende mechanische Eigenschaften. Im Vergleich zu bekannten Materialien wird beispielsweise die Kratzfestigkeit signifikant verbessert.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der Zusammensetzungen Z zur Beschichtung von beliebigen Substraten. Bevorzugte Substrate sind beispielsweise oxidische Materialien, wie z.B. Glas, Metalle, Holz oder Kunststoffe wie Polycarbonat, Polybutylentherephthalat, Polymethylmethacrylat, Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polypropylen.

Die aufgebrachten Beschichtungen dienen zur Verbesserung der Kratzfestigkeit, Abriebbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit oder aber zur Beeinflussung der abhäsiven Eigenschaften.

Das Aufbringen der Zusammensetzungen Z kann durch beliebige Verfahren wie Eintauch-, Sprüh- und Gießverfahren erfolgen.

Auch ein Aufbringen nach einem "wet in wet"-Verfahren ist möglich.

15

10

5

Alle Symbole der vorstehenden Formeln weisen ihre Bedeutungen jeweils unabhängig voneinander auf. In allen Formeln ist das Siliciumatom vierwertig.

20 Soweit nicht anders angegeben sind in den folgenden Beispielen alle Mengen- und Prozentangaben auf das Gewicht bezogen, alle Drücke 0,10 MPa (abs.) und alle Temperaturen 20 °C.

Beispiel 1:

Zu 20,00 g eines SiO₂-Organosols (IPA-ST® der Firma Nissan Chemicals, 30 Gew.-% SiO₂, 12 nm) werden innerhalb von 1 min 2,00 g Methacrylatomethyl-dimethylmethoxysilan getropft und das Gemisch für 16 h auf 60 °C erwärmt. Nach Abkühlen des Gemischs auf Raumtemperatur werden 15,00 g Hexandioldiacrylat zugegeben und anschliessend das Isopropanol unter vermindertem Druck abdestilliert. Die transparente Dispersion enthält 29 Gew.-% SiO₂.

Beispiel 2:

Zu 20,00 g eines wässrigen SiO_2 -Sols (LUDOX® AS 40 der Firma Grace Davison, 40 Gew.-% SiO_2 , pH = 9,1, 22 nm) werden innerhalb

von 60 min 15 ml Ethanol und binnen 5 min 2,00 g
Methacrylatomethyl-dimethylmethoxysilan getropft und das
Gemisch für 16 h auf 60 °C erwärmt. Nach Abkühlen des Gemischs
auf Raumtemperatur werden 15 g Hexandioldiacrylat zugegeben und
anschliessend Ethanol und Wasser als Azeotrop abdestilliert.
Die transparente Dispersion enthält 29 Gew.-% SiO₂.

Beispiel 3:

Zu 20,00 g eines SiO₂-Organosols (IPA-ST® der Firma Nissan

10 Chemicals, 30 Gew.-% SiO₂, 12 nm) werden innerhalb von 1 min

2,00 g Methacrylatomethyl-dimethylmethoxysilan getropft und das

Gemisch für 16 h auf 60 °C erwärmt. Nach Abdestillieren des

Lösungsmittels wird der Rückstand mit 100 ml (5 x 20 ml) Pentan

gewaschen. Zu einer Dispersion von 2,90 g des erhaltenen

15 Feststoffs in 10.ml Ethanol werden 7,10 g HDDA zugegeben und

das Lösungsmittel abdestilliert. Man erhält eine transparente

Dispersion mit einem SiO₂-Gehalt von 29 Gew.-%.

Vergleichsbeispiel 1:

Zu 26,7 g eines SiO₂-Organosols (IPA-ST® der Firma Nissan Chemicals, 30 Gew.-% SiO₂, 12 nm) werden innerhalb von 1 min 15,00 g Hexandioldiacrylat zugegeben, 30 min gerührt und anschliessend das Isopropanol unter vermindertem Druck abdestilliert. Die transparente Dispersion enthält 35 Gew.-% SiO₂.

Vergleichsbeispiel 2:

Zu 20,00 g eines wässrigen SiO₂-Sols (LUDOX® AS 40 der Firma Grace Davison, 40 Gew.-% SiO₂, pH = 9,1, 22 nm) werden innerhalb von 60 min 20 ml Ethanol und binnen 5 min 2,00 g Methacrylatomethyl-trimethoxysilan getropft und das Gemisch für 16 h auf 60 °C erwärmt. Nach Abkühlen des Gemischs auf Raumtemperatur werden 15 g Hexandioldiacrylat zugegeben und anschliessend Ethanol und Wasser als Azeotrop abdestilliert.

35 Die transparente Dispersion enthält 35 Gew.-% SiO₂.

Vergleichsbeispiel 3:

Zu einem Gemisch von 20,00 g eines SiO_2 -Organosols (IPA-ST® der Firma Nissan Chemicals, 30 Gew.-% SiO_2 , 12 nm) und 10 g Wasser werden innerhalb von 1 min 2,00 g Methacrylatopropyl-

trimethoxysilan getropft. Das Gemisch wird für 16 h auf 60 °C erwärmt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur werden 15 g
Hexandioldiacrylat zugegeben und anschliessend Isopropanol und Wasser azeotrop abdestilliert. Die transparente Dispersion enthält 29 Gew.-% SiO₂.

Beispiel 4:

10

15

20

25

Herstellung von Lackfilmen

Die Beschichtungsmassen aus den Beispielen 1, 2, 3 und den Vergleichsbeispielen 1, 2 und 3 sowie eine Beschichtung, die aus reinem 1,6-Hexandioldiacrylat besteht, werden jeweils mittels eines Filmziehgerätes Coatmaster® 509 MC der Fa. Erichsen mit einem Rakel der Spalthöhe 80 µm auf einer Glasplatte aufgerakelt. Anschließend werden die erhaltenen Beschichtungsfilme unter Stickstoff in einem UVA-Cube, Typ UVA-Print 100 CV1 der Fa. Dr. Hönle mit einer Lampenleistung von ca. 60 mW/cm² bei einer Bestrahlungsdauer von 60 s gehärtet. Aus sämtlichen Beschichtungsforumulierungen werden dabei optisch schöne und glatte Beschichtungen erhalten. Der Glanz aller fünf Beschichtungen – bestimmt mit einem Glanzmessgerät Micro gloss 20° der Fa. Byk – lag bei allen 6 Lacken bei ca. 155 Glanz-Einheiten.

Beispiel 5:

Bewertung der Kratzfestigkeit von Lackfilmen

Die Kratzfestigkeit der nach Beispiel 4 erzeugten Lackfilme wird mit einem Scheuerprüfgerät nach Peter-Dahn ermittelt. Hierzu wird ein Scheuervlies Scotch Brite® 07558 mit einer Fläche von 45 x 45 mm mit einem Gewicht von 1 kg beschwert und mit 500 Hüben verkratzt. Sowohl vor Beginn als auch nach Beendigung der Kratzversuche wird der Glanz der jeweiligen Beschichtung mit einem Glanzmessgerät Micro gloss 20° der Fa. Byk gemessen. Als Maß für die Kratzfestigkeit der jeweiligen

WO 2005/092933 PCT/EP2005/002542

Beschichtung wird der Glanzverlust bestimmt (Mittelwert aus jeweils 3 Lackproben):

Lackprobe	Glanzverlust
Beispiel 1	15 ± 4 %
Beispiel 2	10 ± 5 %
Beispiel 3	< 5 %
Vergleichsbeispiel 1	78 ± 7 %
Vergleichsbeispiel 2	25 ± 5 %
Vergleichsbeispiel 3	43 ± 5 %
1,6-Hexandioldiacrylat	75 ± 10 %

Tabelle 1: Glanzverlust beim Kratztest nach Peter-Dahn

WO 2005/092933 PCT/EP2005/002542 16

Patentansprüche

1. Härtbare Zusammensetzungen Z, die ein Bindemittel BM, das mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe trägt, sowie Partikel P enthalten, die über mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe an ihrer Oberfläche verfügen und Reste der allgemeinen Formel I,

$$-SiR^{2}_{2}-(CR^{3}_{2})_{n}-A-D-C$$
 (I),

10

15

25

35

5

aufweisen, wobei

- \mathbb{R}^2 -(CR³₂)_n-A-D-C oder ein Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR4-Gruppen unterbrochen sein kann,
- \mathbb{R}^3 Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR4-Gruppen unterbrochen sein kann,
- R^4 20 Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen,
 - Sauerstoff, Schwefel, =NR4 oder =N-(D--C), Α
 - Carbonylgruppe, Alkylen-, Cycloalkylen- oder Arylenrest mit D jeweils 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, wobei die Kohlenstoffkette durch nicht benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR4-Gruppen unterbrochen sein kann,
 - eine ethylenisch ungesättigte Gruppe und C
 - Werte größer oder gleich 1 bedeuten. n
- Zusammensetzungen Z nach Anspruch 1, bei denen die Partikel 30 2. P herstellbar sind durch Umsetzung von
 - (a) Partikeln P1 aus einem Material, das ausgewählt wird aus Metalloxiden, Metall-Silicium-Mischoxiden, Siliciumdioxid, kolloidalem Siliciumdioxid und Organopolysiloxanharzen und deren Kombinationen, das über Funktionen verfügt, die ausgewählt werden aus Me-OH, Si-OH, Me-O-Me, Me-O-Si, Si-

O-Si, Me-OR1 und Si-OR1,

(b) mit Organosilanen B der allgemeinen Formel II,

$$(R^{1}O) R^{2} Si - (CR^{3})_{n} - A - D - C$$
 (II),

5

bzw. deren Hydrolyse und/oder Kondensationsprodukten,(c) und gegebenenfalls mit Wasser,

wobei

- 10 R¹ Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 6
 Kohlenstoffatomen, dessen Kohlenstoffkette durch nicht
 benachbarte Sauerstoff-, Schwefel-, oder NR⁴-Gruppen
 unterbrochen sein kann,
 - Me ein Metallatom bedeuten und
- 15 R^2 , R^3 , A, D, C und n die bei Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen aufweisen.
- Zusammensetzungen Z nach Anspruch 1, bei denen die Partikel
 P herstellbar sind durch Cohydrolyse von Organosilanen B
 der allgemeinen Formel II mit Alkoxysilanen B* der
 allgemeinen Formel III,

$$(R^5O)_{A=m}(R^6)_mSi$$
 (III),

25 wobei

- R⁵ die Bedeutungen von R¹ aufweisen,
- R⁶ Kohlenwasserstoffrest, der substituiert sein kann und
- m die Werte 0, 1, 2 oder 3 bedeuten.
- 30 4. Zusammensetzungen ${\bf Z}$ nach Anspruch 2 und 3, bei denen der Kohlenwasserstoffrest ${\bf R}^1$ ein Methyl-, Ethyl- oder Phenylrest ist.
 - 5 Zusammensetzungen Z nach Anspruch 1 bis 4, bei denen die

Gruppen (-A-D-C) für die Reste $OC(O)C(CH_3) = CR_2^3$, $OC(O)CH = CR_2^3$, $NHC(O)C(CH_3) = CR_2^3$ oder $NHC(O)CH = CR_2^3$ stehen.

18

PCT/EP2005/002542

6. Zusammensetzungen **Z** nach Anspruch 1 bis 5, bei denen die ethylenisch ungesättigten Gruppen im Bindemittel **BM** befähigt sind zur radikalischen, kationischen oder anionischen Polymerisation.

WO 2005/092933

- 7. Zusammensetzungen Z nach Anspruch 1 bis 6, bei denen die ethylenisch ungesättigten Gruppen im Bindemittel BM polymerisiert werden können durch aktinische Strahlung oder thermische Behandlung.
- 8. Zusammensetzungen Z nach Anspruch 1 bis 7, bei denen die ethylenisch ungesättigten Gruppen im Bindemittel BM ausgewählt werden aus Vinylgruppen, Methacrylatgruppen, Acrylatgruppen und Acrylamidgruppen.
- 9. Zusammensetzungen Z nach Anspruch 1 bis 8, bei denen die
 20 Partikel P1 einen mittleren Durchmesser von kleiner 1000 nm
 besitzen, wobei die Teilchengröße durch
 Transmissionselektronenmikroskopie bestimmt wird.
- 10. Verwendung der Zusammensetzungen **Z** gemäss Anspruch 1 bis 9

 zur Beschichtung von Substraten.

INTENATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/002542

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 CO8F2/44 CO3C C03C17/30 C09C3/12 C08K9/06 C09C1/28 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C08F C03C C08K C09C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. ALTMANNS ET AL: "The X 1 - 10hydrolysis/condensation behaviour of methacryloyloxyalkylfunctio nal alkoxysilanes: structure-reactivity relations" MONATSHEFTE FUER CHEMIE, SPRINGER VERLAG, VIENNA, AT, vol. 134, 12 June 2003 (2003-06-12), pages 1081-1092, XP002328645 ISSN: 0026-9247 cited in the application the whole document P,X WO 2004/089961 A (CONSORTIUM FUER 1 - 10ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH; BRIEHN, CHRISTOPH; KO) 21 October 2004 (2004-10-21) the whole document Further documents are listed in the continuation of box C. χ Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docudocument referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 13 June 2005 17/06/2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Gold, J

INT ATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/EP2005/002542

				101/672	005/002542
Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 2004089961 A	21-10-2004	WO	2004089961	A1	21-10-2004
					
•					

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002542

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C08F2/44 C03C17/30 C08K9/06 C09C3/12 C09C1/28 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C08F C03C C08K IPK 7 C09C Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie® Betr. Anspruch Nr. Χ ALTMANNS ET AL: "The 1 - 10hydrolysis/condensation behaviour of methacryloyloxyalkylfunctio nal alkoxysilanes: structure-reactivity relations" MONATSHEFTE FUER CHEMIE, SPRINGER VERLAG, VIENNA, AT, Bd. 134, 12. Juni 2003 (2003-06-12), Seiten 1081-1092, XP002328645 ISSN: 0026-9247 in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument P,X WO 2004/089961 A (CONSORTIUM FUER 1 - 10ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH; BRIEHN, CHRISTOPH: KO) 21. Oktober 2004 (2004-10-21) das ganze Dokument Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie ΙX entnehmen Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden " Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie verörlicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mot verbindung gebracht wird und diese Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist ausgeführt) Or Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 13. Juni 2005 17/06/2005 Bevoltmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Gold, J

INTERNATIONALIMERECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002542

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
WO 200408996	1 A	21-10-2004	WO	2004089961	A1	21-10-2004	
						·	